



PSI

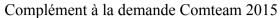
GROUPE(S) CONCERNE(S)	NBS
REFERENCE COMTEAM	NBS-08-10
REFERENCE DANS	P-13-00224
RENATECH LIMS	

RESSOURCES HUMAINES			
Porteur du projet (Nom, prénom)	Leichle, Thierry		
Coordinateur TEAM (Nom, prénom)	Bourrier, David		

FINANCEMENT(S) DU PROJET (Un projet peut avoir plusieurs origines préciser TOUS les supports)				
ORGANISME (ANR, Europe, Carnot, etc.)	NOM DE L'APPEL (Pnano, 7 ^{eme} PCRD, blanc, etc.)	EOTP DU CONTRAT SUPPORT	POUR 2015 sommes à priori prévues pour les réalisations technologiques	
ANR	Blanc	415861	3000€	

BILAN			
En avance	A jour	En retard	Terminé
	X		

Raisons d'un éventuel retard				
Non démarré	Développements procédés	Disponibilité de personnel	Disponibilités d'équipements	









Quel que soit l'état du projet (même terminé) expliciter les développements effectués, les objectifs atteints, les objectifs à atteindre, les problèmes rencontrés, etc...

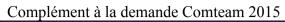
PROCEDES

DESCRIPTION DES ETAPES DU(ES) PROCEDE(S) A VENIR (PROJET EN COURS) OU FINALISE (PROJET TERMINE):

FABRICATION DE NANOCANNAUX PLANNAIRES:

- DOPAGE LOCALISE (AVEC MASQUE D'OXYDE OU IMPLANTE)
- Gravure de microcannaux
- PRISE DE CONTACT ELECTRIQUE (METALLISATION)
- DISSOLUTION ANODIQUE (ELECTROCHIMIE)
- DECOUPE DES PUCES
- SCELLEMENT DES CANNAUX PAR COLLAGE PDMS SUR COVERSLIP/ANODIC BONDING

•







Component a la domana Comount 2010		NATURE PROCEDES Mettre une crois dans la ou les colonnes adaptées		is dans la ou adaptées	NATURE DES TRAVAUX
		ETABLIS	DEVELO PPEMENTS	FORMATIONS (Nb personnes)	Préciser notamment la nature des verrous (Exemple : litho laser : réalisation de masques / photolithographie : procédés classiques / gravure plasma : gravures classiques + développement de la gravure nanométrique dans du polymèreXXx)
LITHOGRAPHIE LASER masques /Ecriture					
PHOTOLITHOGRAPHIE		X			
LITHOGRAPHIE ELECTRONIQUE					
TRAITEMENT THERMIQUE		x			
DEPOTS SOUS VIDE		х			
ELECTROCHIMI	Croissances	X			
Photolithographie moules		X			
GRAVURE HUMIDE KOH, TMAH					
GRAVURE PLASMA		х			
CHIMIE Attaques/ Nettoyages/ Divers		х			
JET D'ENCRE Pro	océdés à développer				
EJM Durée (en heures étalonnages compris)					
NANO IMPRINT UV Procédés à développer					
IMPLANTATION		x			
ASSEMBLAGE	Montages de puces				
	Wafer Bonding, CMP, sérigraphie,	Х			
CARACTERISATION Formations					